



TURBOPUMPS – 涡轮分子泵

提供各种高端应用的完美真空解决方案

涡轮分子泵

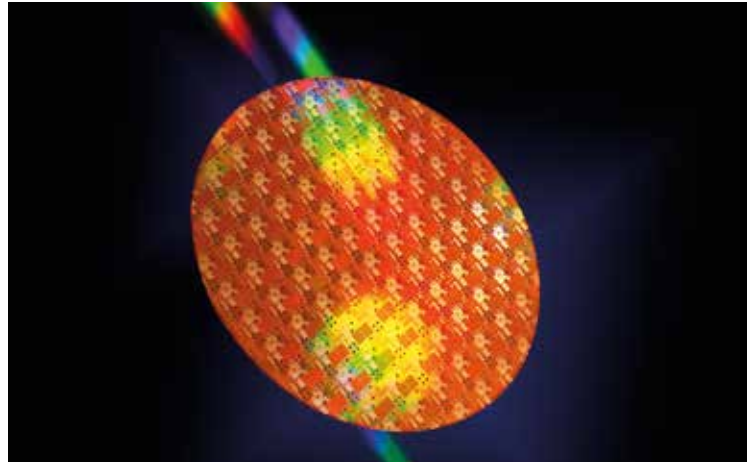
完整的产品线



目录	涡轮分子泵	4
	轴承技术	6
	HiPace® 10–800	8
	抽速等级在10-800升/秒的紧凑型	
	球轴承或复合轴承涡轮分子泵	8
	产品型号及应用领域对照表	9
	抽速和尺寸	10
	技术参数和订货号	12
	HiPace® 1200–2300	14
	抽速等级在1000-2000升/秒的紧凑型	
	复合轴承涡轮分子泵	14
	产品型号及应用领域对照表	15
	抽速和尺寸	16
	技术参数和订货号	18
	HiPace® 300–800 M, ATH 500 M	20
	抽速等级在300-800升/秒的紧凑型	
	磁悬浮涡轮分子泵	20
	产品型号及应用领域对照表	21
	抽速和尺寸	22
	技术参数和订货号	24
	ATH 1600–3200 M, ATP 2300 M	26
	抽速等级在1400-2800升/秒的紧凑型	
	磁悬浮涡轮分子泵	26
	产品型号及应用领域对照表	27
	抽速和尺寸	28
	技术参数和订货号	30

涡轮分子泵

提供各种高端应用的完美真空解决方案



由欧洲核子研究中心(CERN)有情提供

起源

您是否想过为何会有涡轮分子泵？那是因为1958年普发真空杰出的先驱发明了这种划时代的产品-涡轮分子泵。如今，在广泛的应用领域中，我们的涡轮分子泵代表着最新一代的真空解决方案，并且引领着行业的发展方向。其应用范围不仅仅局限于分析仪器、真空工艺过程和半导体技术行业，而且还可以应用于镀膜，研发和其他工业应用领域。

涡轮分子泵家族拥有从抽速10-2700升/秒的全系列产品。它们都拥有着很高的性价比和灵活的安装方式。经过实践验证的轴承系统提供了更优化的可靠性。成熟精湛的转子设计使其具有绝对出色的抽气速度，更好的前级泵兼容性和更大的气流量，对小分子气体具有更高的压缩比。

系列

HiPace® 10 – 800:

抽速等级在10-800升/秒的紧凑型球轴承或复合轴承涡轮分子泵
稳健性工业设计(Robust Design)
最小的空间安装需求
高可靠性

HiPace® 1200 – 2300:

抽速等级在1000-2000升/秒的紧凑型复合轴承涡轮分子泵
高抽速
更大的气流量
更快的启动时间

HiPace® 300 – 800 M, ATH 500 M:

抽速等级在300-800升/秒的紧凑型磁悬浮涡轮分子泵
更大的气流量
更低的运行震动
更低的能耗

ATH 1600 – 3200 M:

抽速等级在1400-2800升/秒的紧凑型磁悬浮涡轮分子泵
更好的前级泵兼容性
极高的气流量
出色的稳定性

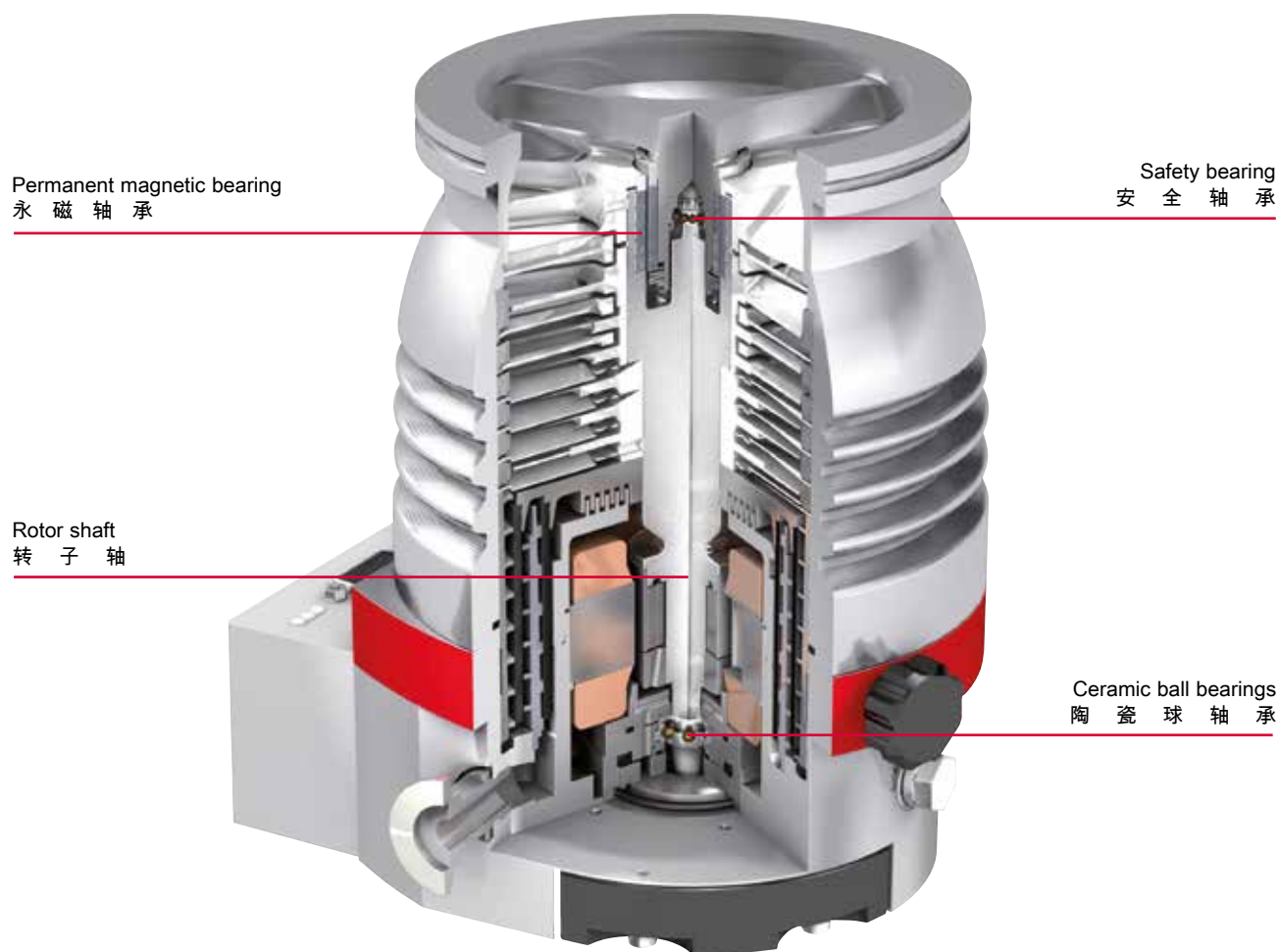


涡轮分子泵

轴承技术

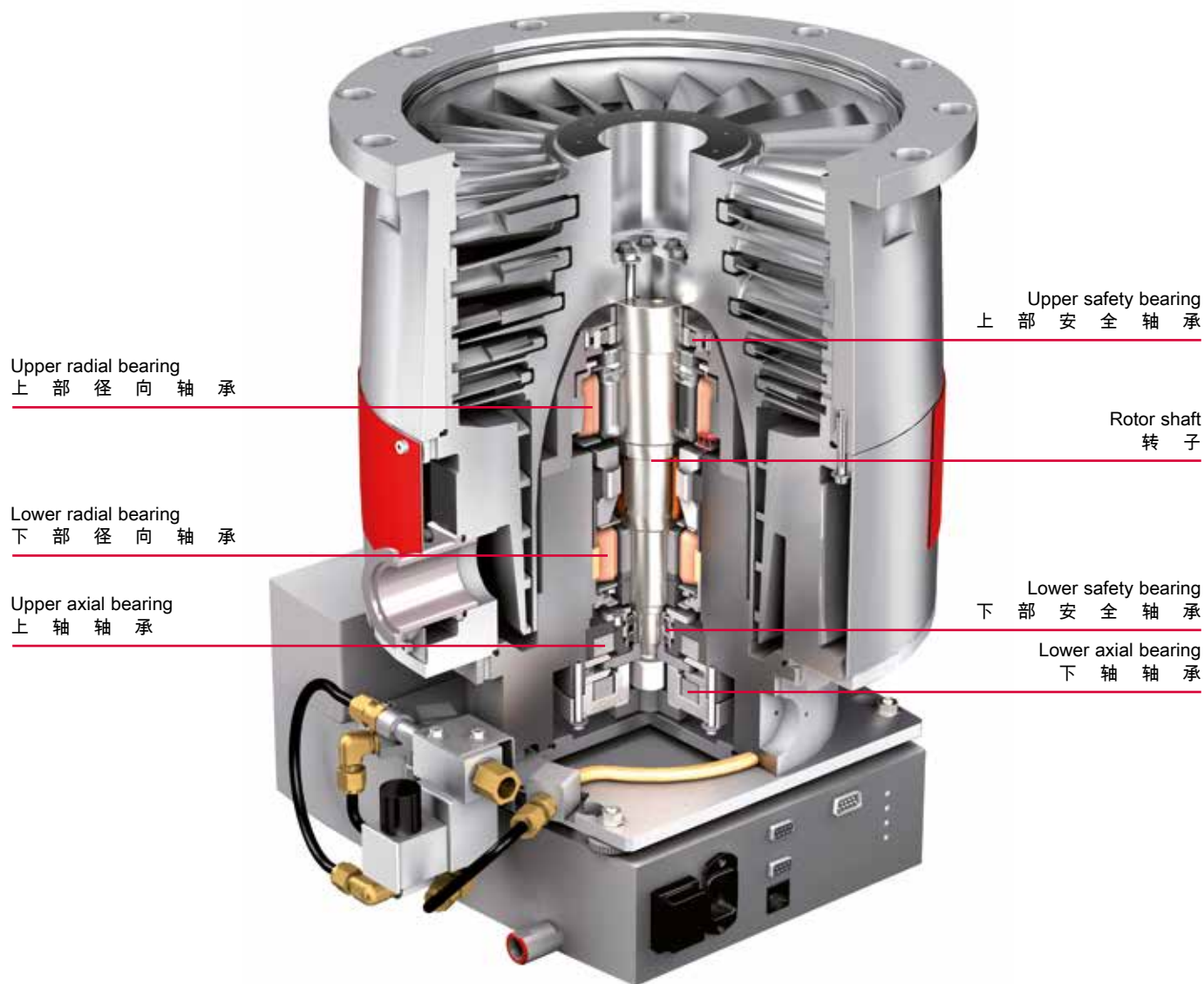
复合轴承

复合轴承就是将前级真空端的陶瓷球轴承和高真空端的永磁径向轴承相结合的设计。这种轴承技术不需要电磁铁，只需每隔约4年维护保养一次，并且可以在30分钟内现场完成陶瓷球轴承和油棉的更换。



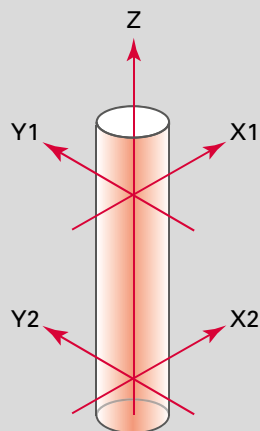
磁悬浮轴承

电磁轴承也被称作“主动式磁悬浮轴承”，其转子位置会被不间断的监测和自动调整并依靠自动平衡补偿来实现无磨损、低震动的运行。转子能持续稳定的工作也更有保障。同时这样的轴承设计也实现了零维护和无润滑油。



固定涡轮分子泵转子

由五个自由度一同固定涡轮分子泵转子，在上下径向水平各有两个点的进行固定，还有一个点来自轴向。



HIPACE® 10–800

抽速等级在10-800升/秒的紧凑型 球轴承或复合轴承涡轮分子泵

HiPace®是什么？

HiPace代表着抽速范围从10-2000升/秒的全系列紧凑且性能卓越的涡轮分子泵。其具有高性价比和安装角度的灵活性。经过实践证明的轴承系统提供了卓越的可靠性。革命性的转子设计使其具有更出色的抽速，更好的前级泵兼容性和更大的气流量，对于小分子气体具有更高的压缩比。

集成控制器

集成控制器减少了对繁琐、昂贵的布线需要。此外，还带有多样化的接口-Profibus, DeviceNet或者E74。由于采用了革新的电子元器件材料，我们集成控制器的使用寿命比原来要长2倍。



HiPace® 10



HiPace® 80



HiPace® 300



HiPace® 800

产品优势

- 抽速从10-800升/秒的全系列产品
- 稳健性工业设计(Robust Design)和经过实践证明的高可靠性轴承系统
- 紧凑型结构以满足更小的物理空间安装需求
- 高气流量和高抽速
- 可任意角度安装¹⁾
- 防护等级IP54符合工业环境应用要求
- 可应用于腐蚀性气体工况
- SEMI S2 和 UL 认证
- 完整的配件系统扩展了潜在客户的需求
- 更长的维护保养时间
- 可现场更换轴承

¹⁾ HiPace C: 0° to 90° / HiPace Plus: 0°

快速启动时间

HiPace的启动时间远快于其他同类产品。这使得其能更快的启动涡轮分子泵。这会为您的生产带来无可估量的经济效益。此外，我们提供扩展功能，可以为您实现远程数据的读取，比如泵的温度等等。先进的自诊断系统使得泵的有效性和技术服务支持变得更有保障。

高性能

基于HiPace精益求精的设计，我们的产品正引领着行业。以HiPace外壳为例，其特殊材料使得泵体的重量轻到了极致，从而扩大了其应用范围。而其转子创新的几何设计使得涡轮分子泵的运行更安静，显著改善气体负荷，建立了分子泵转子的新标准。

应用范围广

HiPace Plus系列是为电子显微镜和高端质谱行业量身定做的产品。HiPace C系列是为腐蚀性气体应用环境而设计的。此外我们还有HiPace P系列，因其能抵抗工业粉尘和微小粒子而广泛应用于工业领域。

产品型号和应用领域对照表

■ 推荐	分析仪器						半导体						镀膜						工业				研发																								
	Electron microscopy - 电子显微镜	Leak detection - 检漏	Mass spectrometry - 质谱	Surface analysis - 表面分析	Plasma monitoring - 等离子体监测	Residual gas analysis - 残余气体分析	Lithography	PVD (Physical Vapor Deposition)	CVD (Chemical Vapor Deposition)	Plasma etching	Implantation – Source	Implantation – Beamline	Inspection	Bonding	MBE (Molecular Beam Epitaxy)	Load-locks, transfer chambers, handling systems	Flat Panel Display (FPD) - 平板显示	LED / OLED	Hard disk coating - 硬盘镀膜	Photovoltaics - 光伏	Glass coating (PVD) - 玻璃镀膜	CD / DVD / Blu-ray production (PVD)	Optical coating (PVD) - 光学镀膜	Wear protection (PVD, CVD) - 硬质涂层	Web coating - 卷绕镀膜	Medical technology - 医学技术	Industrial leak detection - 工业检漏	Electron beam welding - 电子束焊接	Isolation vacuums - 隔离真空	Lamp and tube manufacturing - 灯管制造	Heat treatment - 热处理	Vacuum drying - 真空干燥	Vacuum furnaces - 真空炉	Nuclear research - 核研究	Fusion technology - 聚变技术	Plasma research - 等离子研究	Particle accelerators - 粒子加速器	Space simulation - 模拟空间站	Cryogenic research - 冷冻研究	Elementary particle physics - 基本粒子物理学	Nanotechnology - 纳米技术	Biotechnology - 生物技术					
HiPace® 10	■	■	■	■		■																				■	■																				
HiPace® 60 P																				■																											
HiPace® 80		■	■	■	■									■	■	■											■	■																			
HiPace® 300		■	■	■	■	■								■	■	■											■	■																			
HiPace® 300 C		■	■	■	■	■								■	■	■																															
HiPace® 300 P		■	■	■	■	■								■	■	■																															
HiPace® 300 Plus	■					■																																									
HiPace® 400				■	■	■								■	■	■					■		■	■	■		■	■																			
HiPace® 400 P				■	■	■								■	■	■					■		■	■	■		■	■																			
HiPace® 700				■	■	■										■					■		■	■	■		■	■																			
HiPace® 700 P				■	■	■										■					■		■	■	■		■	■																			
HiPace® 700 Plus	■			■	■	■											■																														
HiPace® 800				■	■	■								■	■	■					■		■	■	■		■																				
HiPace® 800 P				■	■	■								■	■	■					■		■	■	■		■																				

P = 工艺泵，抗粉尘

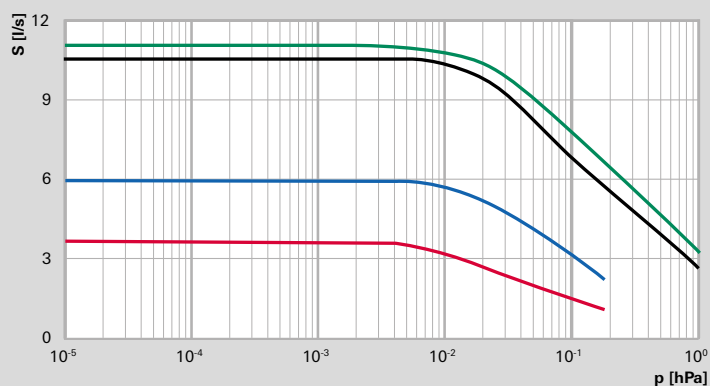
C = 抗腐蚀性气体

HIPACE® 10–800

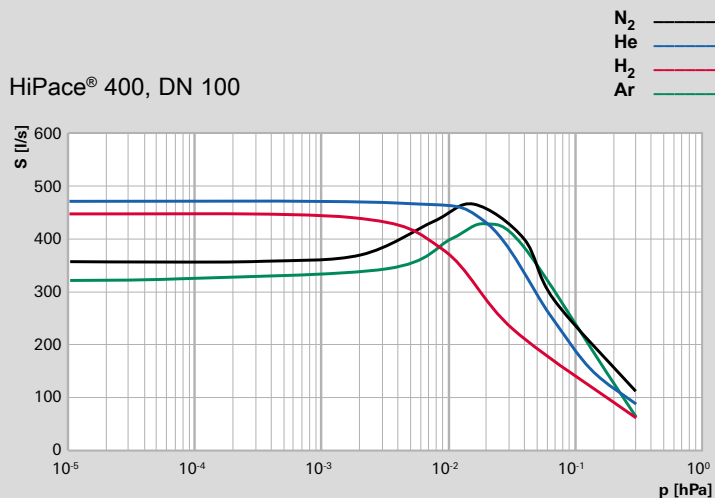
抽速和尺寸

抽速

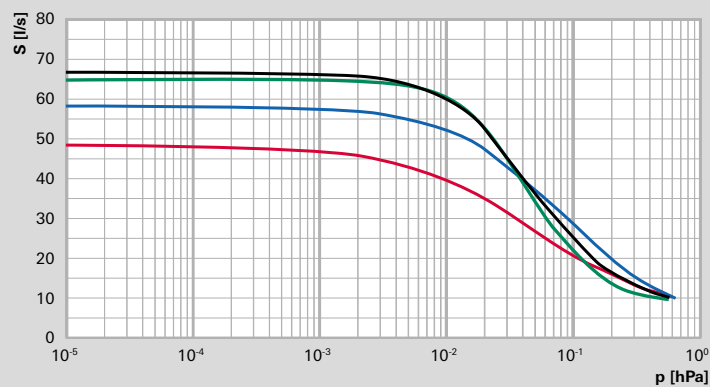
HiPace® 10, DN 25



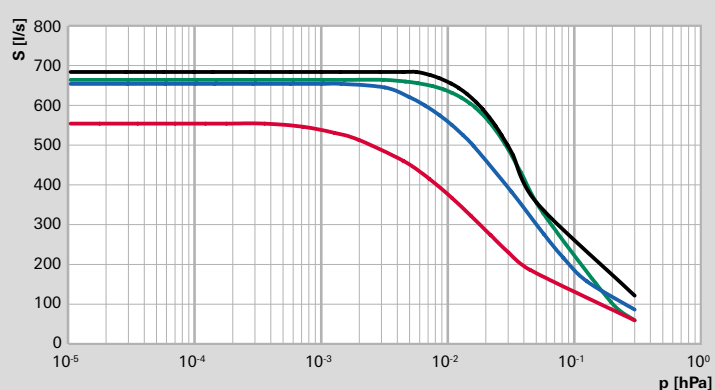
HiPace® 400, DN 100



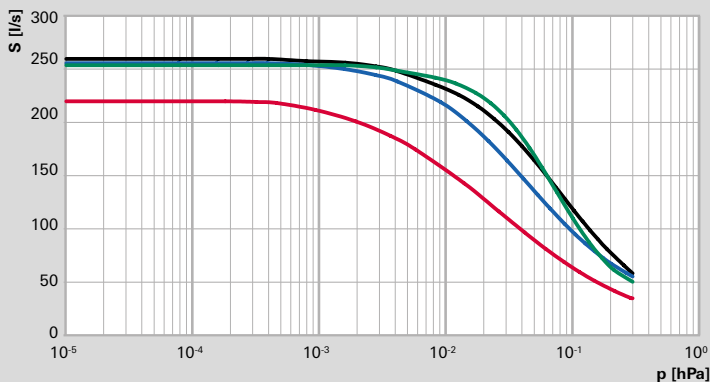
HiPace® 80, DN 63



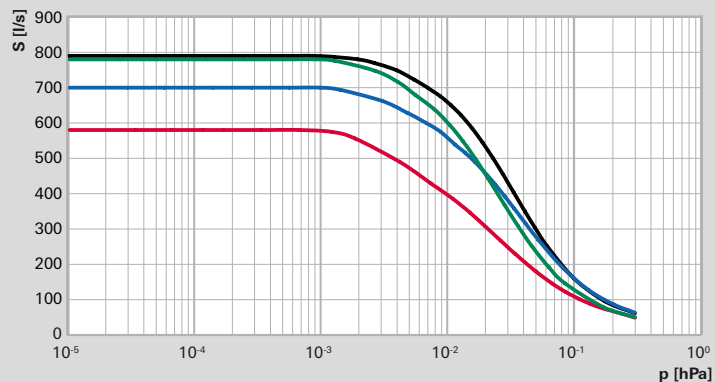
HiPace® 700, DN 160



HiPace® 300, DN 100

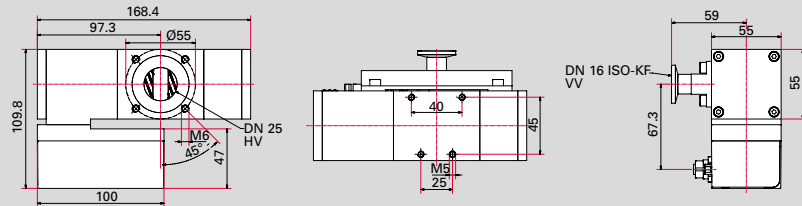


HiPace® 800, DN 200

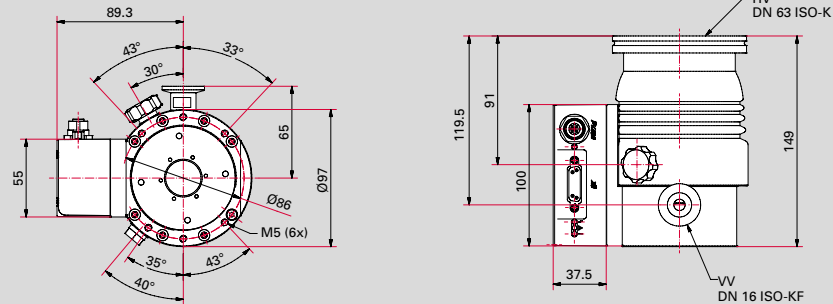


尺寸

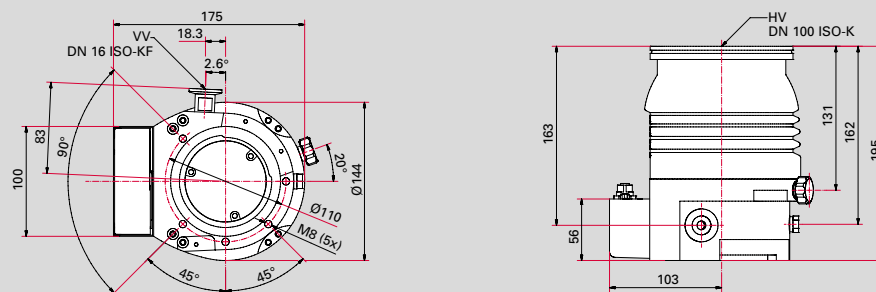
HiPace® 10,
DN 25 with TC 110



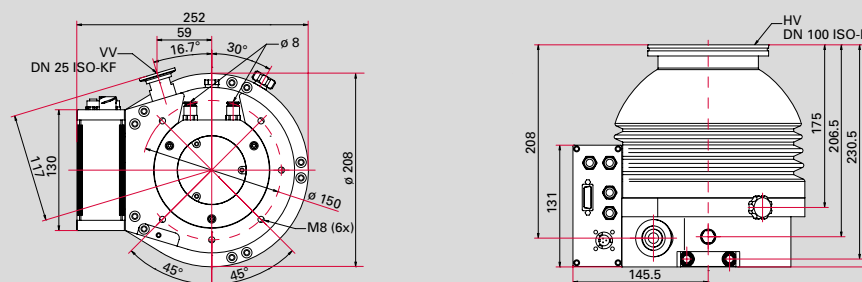
HiPace® 80,
DN 63 ISO-K with TC 110



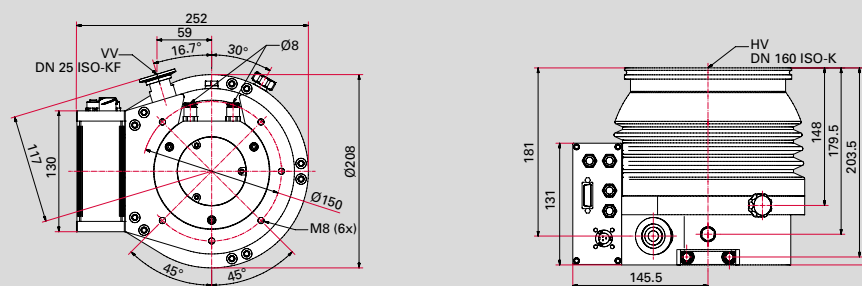
HiPace® 300,
DN 100 ISO-K with TC 110



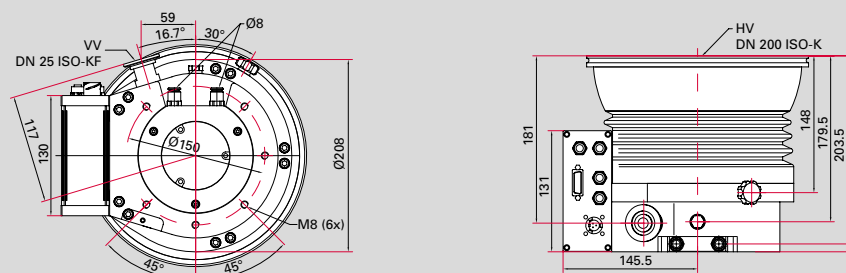
HiPace® 400, DN 100 ISO-K
with TC 400



HiPace® 700,
DN 160 ISO-K with TC 400



HiPace® 800,
DN 200 ISO-K with TC 400



HIPACE® 10–800

技术参数和订货号

技术参数

Pump type	Unit	HiPace® 10	HiPace® 80	HiPace® 300 ¹⁾	HiPace® 300 ²⁾
Connection nominal diameter					
Flange (in)	ISO-KF	DN 25	DN 63	DN 100	DN 100
Flange (out)		DN 16	DN 16	DN 16	DN 16
Venting connection		–	G 1/8"	G 1/8"	G 1/8"
Pumping speed for:					
Nitrogen (N ₂)	l/s	10	67	260	260
Helium (He)	l/s	6	58	255	255
Hydrogen (H ₂)	l/s	3.7	48	220	220
Argon (Ar)	l/s	11.5	66	255	255
Compression ratio for:					
Nitrogen (N ₂)		3 · 10 ⁶	> 1 · 10 ¹¹	> 1 · 10 ¹¹	> 1 · 10 ¹¹
Helium (He)		3 · 10 ³	1.3 · 10 ⁷	> 1 · 10 ⁸	> 1 · 10 ⁸
Hydrogen (H ₂)		3 · 10 ²	1.4 · 10 ⁵	9 · 10 ⁵	9 · 10 ⁵
Argon (Ar)		2.5 · 10 ⁷	> 1 · 10 ¹¹	> 1 · 10 ¹¹	> 1 · 10 ¹¹
Max. fore-vacuum pressure for					
Nitrogen (N ₂)	hPa	25	22	15	20
Max. gas throughput at full rotational speed for					
Nitrogen (N ₂)	hPa l/s	0.37	1.3	5	14
Ultimate pressure	hPa	< 5 · 10 ⁻⁵	< 1 · 10 ⁻⁷	< 1 · 10 ⁻⁷	< 1 · 10 ⁻⁷
Rotation speed	RPM	90,000	90,000	60,000	60,000
Run-up time	min	0.9	1.75	3.5	1.8
Cooling type, Standard		Convection	Convection	Air	Water
Cooling water consumption	l/min	–	–	–	0.83
Cooling water temperature	°C	–	–	–	15–35
Operating voltage ³⁾	V DC	24 ± 5%	24 ± 5%	24 ± 5%	24 ± 5%
Max. power consumption	W	28.8	110	180	300
Weight	kg	1.8	2.4	5.8 – 8.2	6.7 – 8.7

¹⁾with drive electronics TC 110

²⁾with drive electronics TC 400

³⁾with drive electronics

You can find additional technical data and accessories on the Internet at: www.pfeiffer-vacuum.com

订货号

Pump type	HiPace® 10	HiPace® 80			HiPace® 300		
Drive \ flange	DN 25	DN 40 ISO-KF	DN 63 ISO-K	DN 63 CF-F	DN 100 ISO-K	DN 100 ISO-F	DN 100 CF-F
TC 110	PM P03 960	PM P03 942	PM P03 940	PM P03 941	PM P03 990	PM P03 992	PM P03 991
TC 400	–	–	–	–	PM P03 900	PM P03 902	PM P03 901
TCP 350	–	PM P03 945	PM P03 943	PM P03 944	PM P03 993	PM P03 995	PM P03 994

技术参数

Pump type	Unit	HiPace® 400	HiPace® 700	HiPace® 800
Connection nominal diameter				
Flange (in)		DN 100	DN 160	DN 200
Flange (out)	ISO-KF	DN 25	DN 25	DN 25
Venting connection		G 1/8"	G 1/8"	G 1/8"
Pumping speed for:				
Nitrogen (N ₂)	l/s	355	685	790
Helium (He)	l/s	470	655	700
Hydrogen (H ₂)	l/s	445	555	580
Argon (Ar)	l/s	320	665	780
Compression ratio for:				
Nitrogen (N ₂)		$> 1 \cdot 10^{11}$	$> 1 \cdot 10^{11}$	$> 1 \cdot 10^{11}$
Helium (He)		$3 \cdot 10^7$	$3 \cdot 10^7$	$3 \cdot 10^7$
Hydrogen (H ₂)		$4 \cdot 10^5$	$4 \cdot 10^5$	$4 \cdot 10^5$
Argon (Ar)		$> 1 \cdot 10^{11}$	$> 1 \cdot 10^{11}$	$> 1 \cdot 10^{11}$
Max. fore-vacuum pressure for				
Nitrogen (N ₂)	hPa	11	11	11
Max. gas throughput at full rotational speed for				
Nitrogen (N ₂)	hPa l/s	6.5	6.5	6.5
Ultimate pressure	hPa	$< 1 \cdot 10^{-7}$	$< 1 \cdot 10^{-7}$	$< 1 \cdot 10^{-7}$
Rotation speed	RPM	49,200	49,200	49,200
Run-up time	min	2	2	2
Cooling type, Standard		Water	Water	Water
Cooling water consumption	l/min	1.6	1.6	1.6
Cooling water temperature	°C	15 – 35	15 – 35	15 – 35
Operating voltage ¹⁾	V DC	48 ± 5%	48 ± 5%	48 ± 5%
Max. power consumption	W	420	400	420
Weight	kg	11.6 – 17.5	11.5 – 17.4	12.8 – 19.1

¹⁾with drive electronics

You can find additional technical data and accessories on the Internet at: www.pfeiffer-vacuum.com

订货号

Pump type	HiPace® 400			HiPace® 700		
Drive \ flange	DN 100 ISO-K	DN 100 ISO-F	DN 100 CF-F	DN 160 ISO-K	DN 160 ISO-F	DN 160 CF-F
TC 110	–	–	–	–	–	–
TC 400	PM P04 023	PM P04 025	PM P04 024	PM P03 933	PM P03 935	PM P03 934
TCP 350	PM P04 026	PM P04 028	PM P04 027	PM P04 080	PM P04 082	PM P04 081

Pump type	HiPace® 800		
Drive \ flange	DN 200 ISO-K	DN 200 ISO-F	DN 200 CF-F
TC 110	–	–	–
TC 400	PM P04 300	PM P04 302	PM P04 301
TCP 350	–	–	–

HIPACE® 1200–2300

抽速等级在1000-2000升/秒的紧凑型 复合轴承涡轮分子泵

智能传感器

HiPace 1200 - 2300系列涡轮分子泵可以倒置安装。经过实践证明的轴承技术确保了其绝对的可靠性。成熟精湛的转子设计使其具有更出色的抽速，更好的前级泵兼容性和更大的气流量，对于小分子气体具有更高的压缩比。集成可靠的智能传感器系统，HiPace系列当仁不让的成为市场上安全性能最好的产品。

高效能技术

经过实践证明不断优化的轴承系统，我们的技术无论在产品性能上还是在使用保养寿命上都远胜于同行业其它产品。同时HiPace系列都提供密封气体连接，密封气体连接避免了颗粒物或氧化气体对轴承的影响。因此HiPace系列不仅结构更加紧凑，几乎完美的集成性能也使其能很好的在极端恶劣的工况条件下胜任工作。时间就是金钱-更长的维护保养时间间隔，更低的故障率及现场在线更换轴承都是其不言而喻的优势。



HiPace® 1200



HiPace® 1500



HiPace® 1800



HiPace® 2300

产品优势

- 从1000-2000升/秒提供四个抽速等级
- 对小分子量气体(H₂, He)和大分子量气体(Ar, CF₄)都有很高的抽速
- 即便对大分子量气体(Ar, CF₄)也有很高的气流量
- 安装角度可选0°-90°和90°-180°
- 有抗腐蚀性气体型号可选(C型号)
- 带节流阀和阀门的集成净化气体系统
- 电压范围90 - 265 V
- 界面接口：RS-485, 远程控制；Profibus或DeviceNet可选
- 获得SEMI S2, UL, CSA和 TÜV认证
- 防护等级IP54符合工业环境应用要求
- 最大可能的符合各种工艺过程，能够忍受颗粒物

集成控制器

集成控制器减少了对繁琐、昂贵的布线需要。此外，在没有增加任何尺寸的前提下，可以提供多种界面接口。通过革新的电子元器件，电子装置的使用寿命翻番。HiPace系列的启动时间也是其一大特点，更快的启动时间使其能在更短的时间内进入工作状态。此外，我们提供扩展的功能。这就以便您能远程分析涡轮分子泵的技术数据，例如温度等。先进的智能化自诊断系统最大程度上为您提供了维护保养所需的基础数据，给维修保养工作带有了很大的支持。

精湛的设计

基于HiPace精益求精的设计，我们的产品正引领着行业。以HiPace外壳为例，其特殊材料使得泵体的重量轻到了极致，从而扩大了其应用范围。其转子创新的几何设计使得涡轮分子泵的运行更安静，显著改善气体负荷，从而建立了分子泵转子的新标准。同时集成化的冷却系统确保了涡轮分子泵性能的进一步提高，而不会有过载现象。

型号和相关应用概览

■ 推荐	分析仪器						半导体						镀膜						工业				研发																																
	Electron microscopy - 电子显微镜	Leak detection - 检漏仪	Mass spectrometry - 质谱	Surface analysis - 表面分析	Plasma monitoring - 等离子体监测	Residual gas analysis - 残余气体分析	Lithography	PVD (Physical Vapor Deposition)	CVD (Chemical Vapor Deposition)	Plasma etching	Implantation – Source	Implantation – Beamline	Inspection	Bonding	MBE (Molecular Beam Epitaxy)	Load-locks, transfer chambers, handling systems	Flat Panel Display (FPD) - 平板显示	LED / OLED	Hard disk coating - 硬盘镀膜	Photovoltaics - 光伏	Glass coating (PVD) - 玻璃镀膜	CD / DVD / Blu-ray production (PVD)	Optical coating (PVD) - 光学镀膜	Wear protection (PVD, CVD) - 硬质涂层	Web coating - 卷绕镀膜	Medical technology - 医学技术	Industrial leak detection - 工业检漏	Electron beam welding - 电子束焊接	Isolation vacuums - 隔离真空	Lamp and tube manufacturing - 灯管制造	Heat treatment - 热处理	Vacuum drying - 真空干燥	Vacuum furnaces - 真空炉	Nuclear research - 核研究	Fusion technology - 聚变技术	Plasma research - 等离子研究	Particle accelerators - 粒子加速器	Space simulation - 模拟空间站	Cryogenic research - 冷冻研究	Elementary particle physics - 基本粒子物理学	Nanotechnology - 纳米技术	Biotechnology - 生物技术													
HiPace® 1200							■											■	■																																				
HiPace® 1200 C							■	■			■	■				■			■																																				
HiPace® 1200 T										■	■							■																																					
HiPace® 1500								■	■			■					■	■																																					
HiPace® 1500 C								■	■		■	■				■																																							
HiPace® 1500 T									■	■	■	■						■																																					
HiPace® 1800								■	■			■																																											
HiPace® 1800 C								■	■		■	■				■																																							
HiPace® 1800 T									■	■	■	■																																											
HiPace® 2300								■	■			■					■		■																																				
HiPace® 2300 C								■	■		■	■				■																																							
HiPace® 2300 T									■	■									■																																				

C = 抗腐蚀性气体

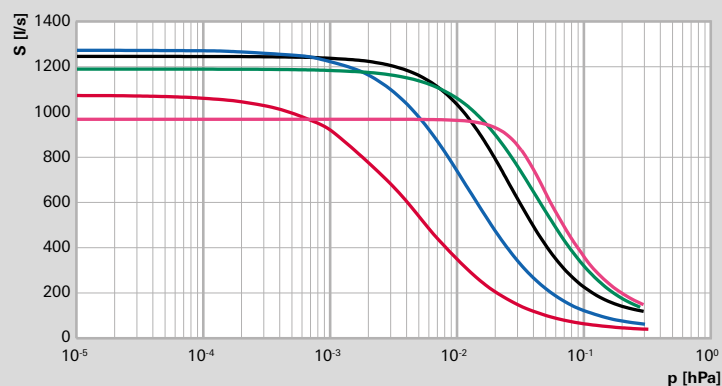
T = 温控管理

HIPACE® 1200–2300

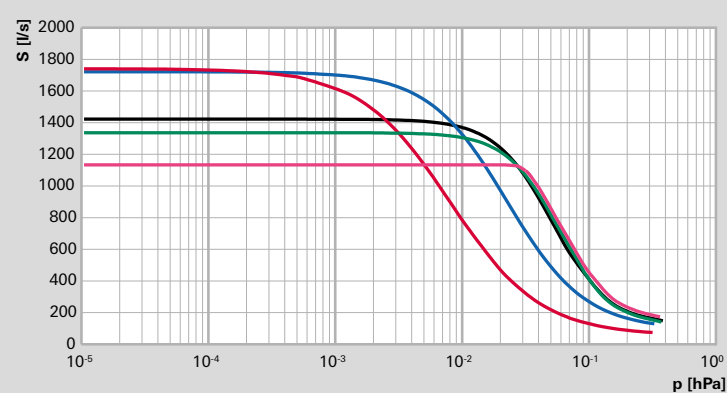
抽速和尺寸

抽速

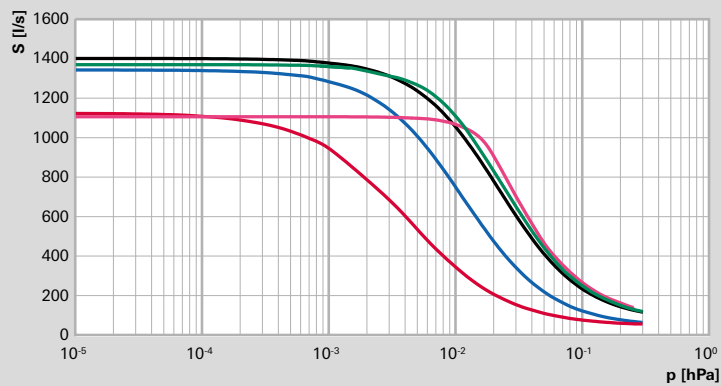
HiPace® 1200, DN 200



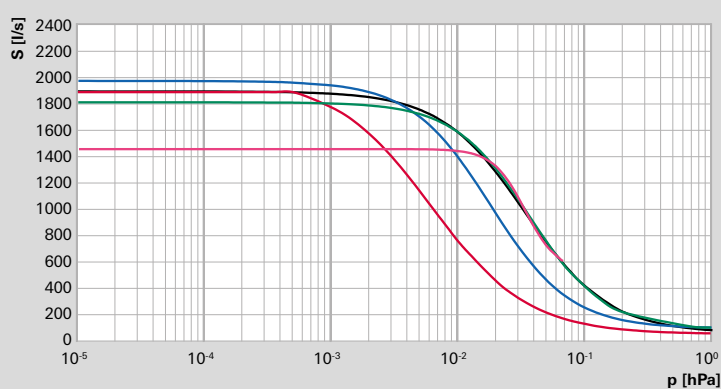
HiPace® 1800, DN 200



HiPace® 1500, DN 250



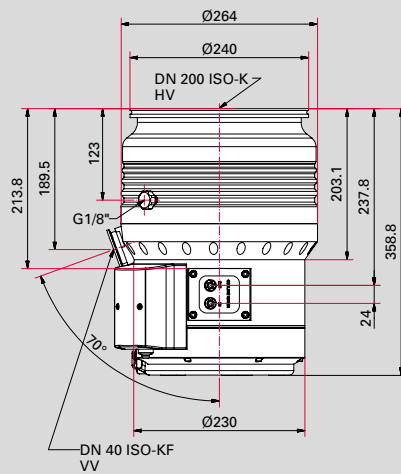
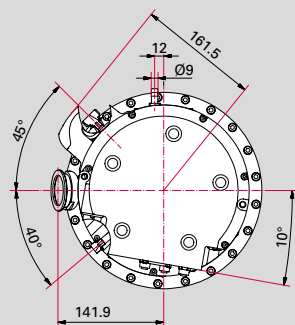
HiPace® 2300, DN 250



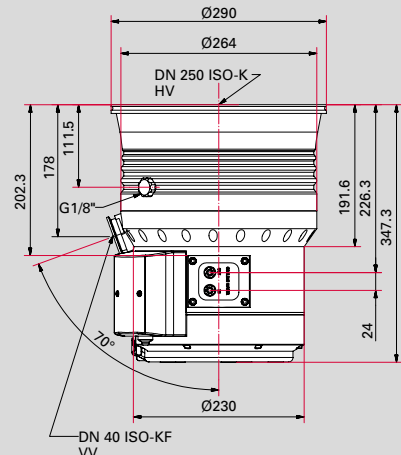
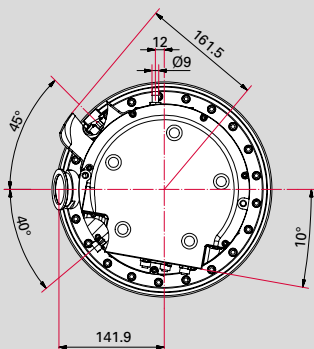
N_2 —
 He —
 H_2 —
 Ar —
 CF_4 —

尺寸

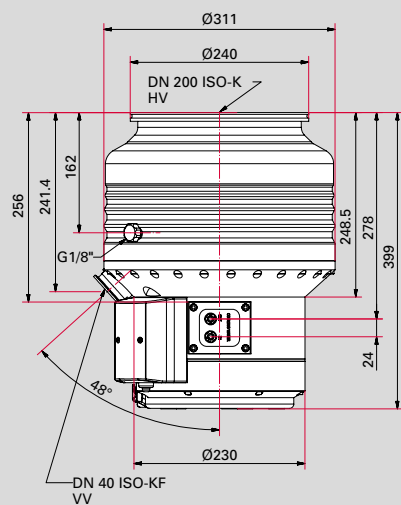
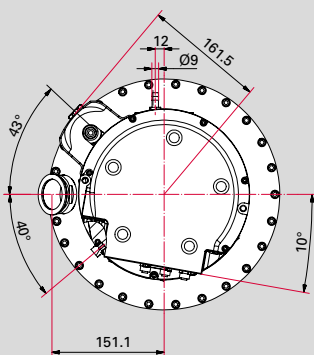
HiPace® 1200,
DN 200 ISO-K



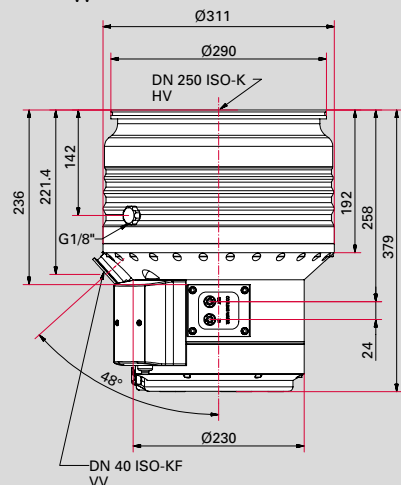
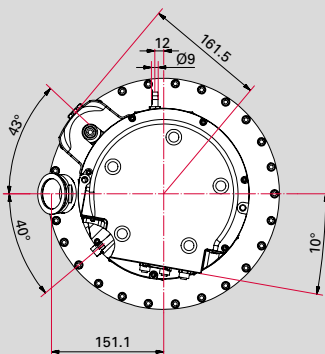
HiPace® 1500,
DN 250 ISO-K



HiPace® 1800,
DN 200 ISO-K



HiPace® 2300,
DN 250 ISO-K



HIPACE® 1200 – 2300

技术参数和订货号

技术参数

Pump type	Unit	HiPace® 1200	HiPace® 1500	HiPace® 1800	HiPace® 2300
Connection nominal diameter					
Flange (in)		DN 200	DN 250	DN 200	DN 250
Flange (out)	ISO-KF	DN 40	DN 40	DN 40	DN 40
Venting connection		G 1/8"	G 1/8"	G 1/8"	G 1/8"
Pumping speed for					
Nitrogen (N ₂)	l/s	1,250	1,400	1,450	1,900
Helium (He)	l/s	1,300	1,350	1,650	2,000
Hydrogen (H ₂)	l/s	1,100	1,150	1,700	1,850
Argon (Ar)	l/s	1,200	1,350	1,370	1,800
Tetrafluoromethane (CF ₄)	l/s	950	1,100	1,050	1,450
Compression ratio for					
Nitrogen (N ₂)		$> 1 \cdot 10^8$	$> 1 \cdot 10^8$	$> 1 \cdot 10^8$	$> 1 \cdot 10^8$
Helium (He)		$2 \cdot 10^5$	$2 \cdot 10^5$	$3 \cdot 10^5$	$3 \cdot 10^5$
Hydrogen (H ₂)		$6 \cdot 10^3$	$6 \cdot 10^3$	$2 \cdot 10^4$	$2 \cdot 10^4$
Argon (Ar)		$> 1 \cdot 10^8$	$> 1 \cdot 10^8$	$> 1 \cdot 10^8$	$> 1 \cdot 10^8$
Tetrafluoromethane (CF ₄)		$> 1 \cdot 10^8$	$> 1 \cdot 10^8$	$> 1 \cdot 10^8$	$> 1 \cdot 10^8$
Max. fore-vacuum pressure for					
Nitrogen (N ₂)	hPa	2	2	1.8	1.8
Max. gas throughput at full rotational speed for					
Nitrogen (N ₂)	hPa l/s	20	20	20	20
Helium (He)	hPa l/s	> 30	> 30	20	20
Hydrogen (H ₂)	hPa l/s	> 30	> 30	20	> 30
Argon (Ar)	hPa l/s	11	11	16	16
Tetrafluoromethane (CF ₄)	hPa l/s	12	12	14	14
Ultimate pressure ¹⁾	hPa	$< 1 \cdot 10^{-7}$	$< 1 \cdot 10^{-7}$	$< 1 \cdot 10^{-7}$	$< 1 \cdot 10^{-7}$
Rotation speed	RPM	37,800	37,800	31,500	31,500
Run-up time	min	2.5	2.5	4	4
Cooling type, Standard		Water	Water	Water	Water
Cooling water consumption ²⁾	l/h	100	100	100	100
Cooling water temperature	°C	15 – 35	15 – 35	15 – 35	15 – 35
Power connection: voltage	V AC	100 – 120/ 200 – 240	100 – 120/ 200 – 240	100 – 120/ 200 – 240	100 – 120/ 200 – 240
Max. power consumption	W	1,350	1,350	1,350	1,350
Weight	kg	27 – 40	29 – 41	33 – 34	34 – 47

¹⁾Measured with oil-free backing pump purged with inert gas, not tempered, elastomer sealed

²⁾At maximum gas throughput and cooling water temperature of 25 °C

You can find additional technical data and accessories on the Internet at: www.pfeiffer-vacuum.com

订货号

Flange Orientation of the HV flange	ISO-K up (0° – 90°)	ISO-F	CF-F	ISO-K upside down (90° – 180°)	ISO-F	CF-F
Pump type	HiPace® 1200, DN 200, TC 1200					
Standard version	PM P03 910	PM P03 911	PM P03 912	PM P03 913	PM P03 914	PM P03 915
Corrosive gas version	PM P03 916	PM P03 917	PM P04 190	PM P03 918	PM P03 919	PM P04 191
Pump type	HiPace® 1500, DN 250, TC 1200					
Standard version	PM P04 060	PM P04 061	PM P04 062	PM P04 063	PM P04 064	PM P04 065
Corrosive gas version	PM P04 066	PM P04 067	PM P04 192	PM P04 068	PM P04 069	PM P04 193
Pump type	HiPace® 1800, DN 200, TC 1200					
Standard version	PM P06 200	PM P06 201	–	PM P06 210	PM P06 211	–
Corrosive gas version	PM P04 076	PM P04 077	–	PM P04 078	PM P04 079	–
Pump type	HiPace® 2300, DN 250, TC 1200					
Standard version	PM P06 300	PM P06 301	PM P06 302	PM P06 310	PM P06 311	PM P06 312
Corrosive gas version	PM P03 926	PM P03 927	PM P04 194	PM P03 928	PM P03 929	PM P04 195

HIPACE® 300 – 800 M, ATH 500 M

抽速等级在300-800升/秒的紧凑型 磁悬浮涡轮分子泵

技术上的完美杰作

HiPace M和ATH 500 M拥有5轴磁轴承。利用这种轴承技术，转子的位置能被实时控制。在工作中，动平衡装置会进行自动校准，可以最小程度上减轻震动和工艺过程中产生的轴承位移。低能耗和极低的维护成本确保了其极高的性价比。

超强的兼容性

是否觉得不同的界面接口标准让您头疼不已？我们的磁悬浮涡轮分子泵能提供集成化的电子驱动装置供您选择，从而满足各种不同界面接口的连接需要。



HiPace® 300 M



ATH 500 M



HiPace® 700 M



HiPace® 800 M

产品优势

- 安装简便
- 任意角度安装
- 集成控制器
- 无润滑油的磁轴承技术实现真正的洁净真空
- 对所有过程气体都能实现高气流量
- 低震动及低磁场干扰
- 动平衡自动补偿
- 转速范围大
- 出色的稳定性和可靠性

业界领先

在极高的抽速、压缩比和气流量的情况下，所产生的震动却是微乎其微的，这才是客户所期望的真正理想的真空环境。5轴磁悬浮泵在业界获得了出色的性能参数，使其成为分析仪器、研发这类洁净制成和镀膜、半导体工艺这类反应制成共同的选择。

安全性高

我们免维护的磁悬浮系列涡轮分子泵采用高质量和高安全系数的轴承以确保运行的绝对安全。即便在极其苛刻的工况环境下工作，由于我们通过了IP54防护等级，HiPace系列磁悬浮泵也能轻松胜任。同时根据ISO27892标准的产品测试也显示我们所有的泵都通过了极其严格的安全测试要求。

产品型号和应用领域对照表

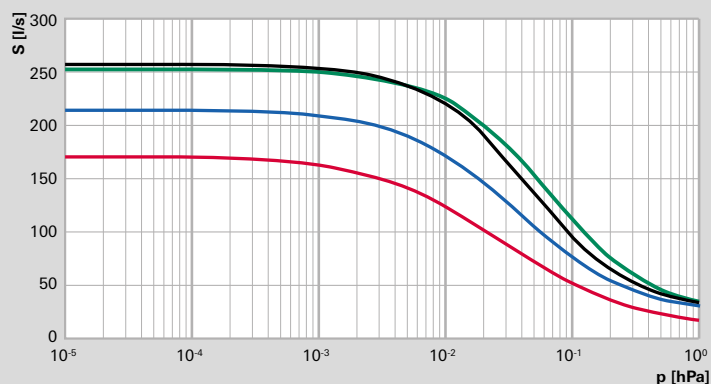
		分析仪器						半导体						镀膜						工业				研发																				
		Electron microscopy - 电子显微镜	Leak detection-检漏	Mass spectrometry - 质谱	Surface analysis - 表面分析	Plasma monitoring - 等离子体监测	Residual gas analysis - 残余气体分析	Lithography	PVD (Physical Vapor Deposition)	CVD (Chemical Vapor Deposition)	Plasma etching	Implantation – Source	Implantation – Beamline	Inspection	Bonding	MBE (Molecular Beam Epitaxy)	Load-locks, transfer chambers, handling systems	Flat Panel Display (FPD) - 平板显示	LED / OLED	Hard disk coating - 硬盘镀膜	Photovoltaics - 光伏	Glass coating (PVD) - 玻璃镀膜	CD / DVD / Blu-ray production (PVD)	Optical coating (PVD) - 光学镀膜	Wear protection (PVD, CVD) - 硬质涂层	Web coating - 卷绕镀膜	Medical technology - 医学技术	Industrial leak detection - 工业检漏	Electron beam welding - 电子束焊接	Isolation vacuums - 隔离真空	Lamp and tube manufacturing - 灯管制造	Heat treatment - 热处理	Vacuum drying - 真空干燥	Vacuum furnaces - 真空炉	Nuclear research - 核研究	Fusion technology - 聚变技术	Plasma research - 等离子研究	Particle accelerators - 粒子加速器	Space simulation - 模拟空间站	Cryogenic research - 冷冻研究	Elementary particle physics - 基本粒子物理学	Nanotechnology - 纳米技术	Biotechnology - 生物技术	
■ 推荐																																												
HiPace® 300 M																																												
ATH 500 M																																												
ATH 500 MT																																												
HiPace® 700 M																																												
HiPace® 800 M																																												

HIPACE® 300–800 M, ATH 500 M

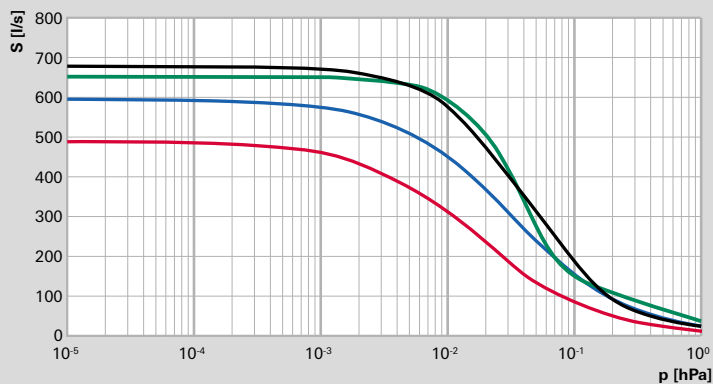
抽速和尺寸

抽速

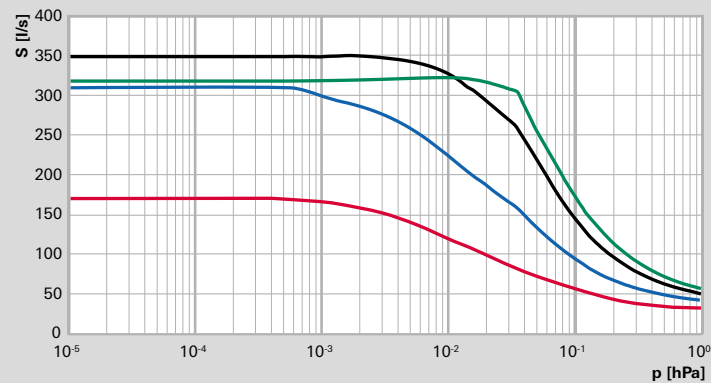
HiPace® 300 M, DN 100



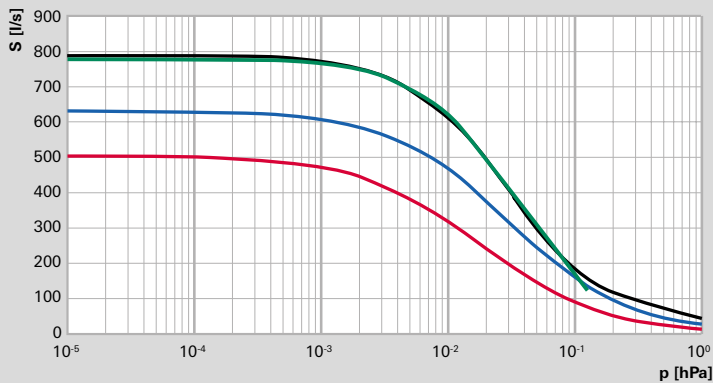
HiPace® 700 M, DN 160



ATH 500 M, DN 160



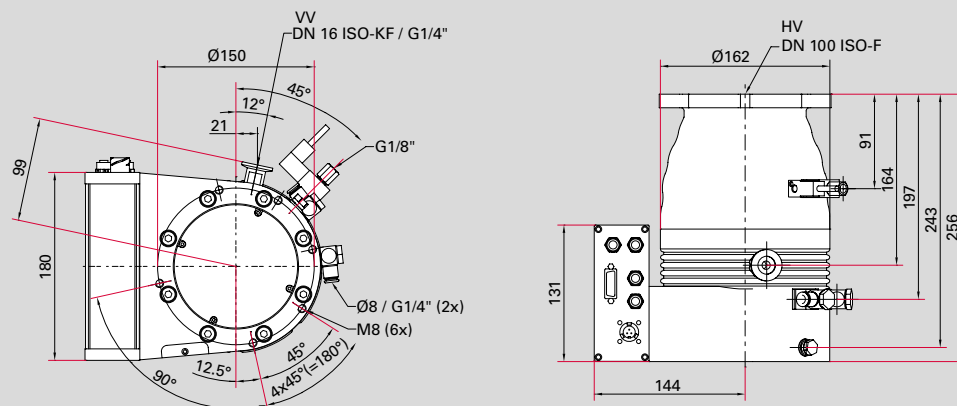
HiPace® 800 M, DN 200



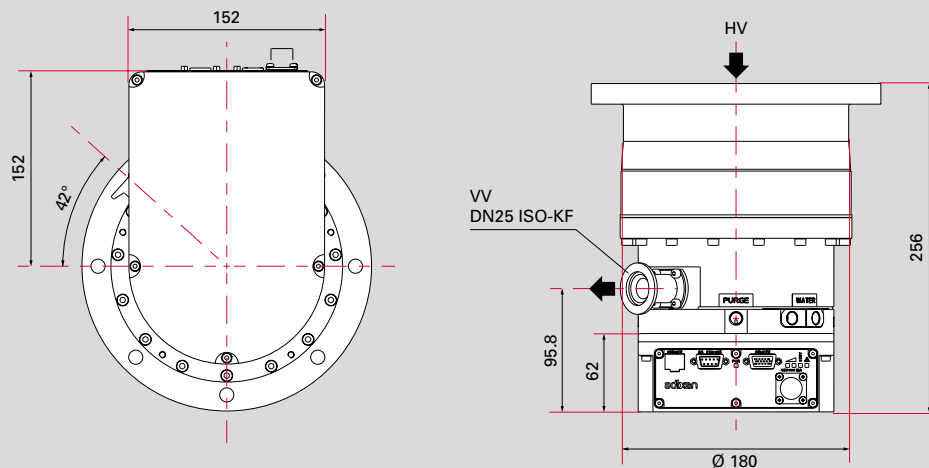
N_2 —
 He —
 H_2 —
 Ar —

尺寸

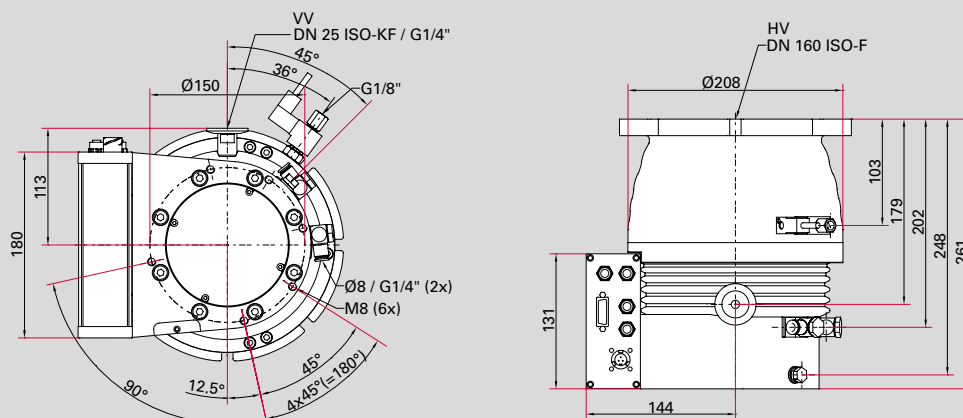
HiPace® 300 M,
DN 100 ISO-F



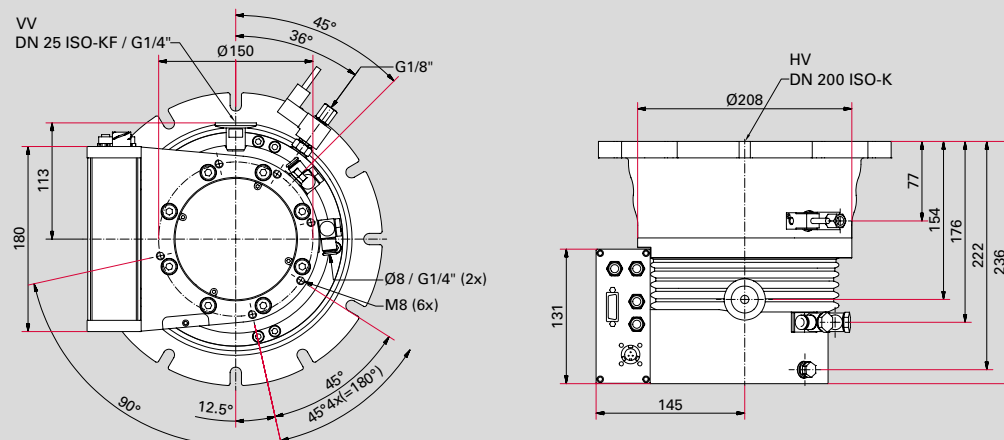
ATH 500 M,
DN 160 ISO-F



HiPace® 700 M,
DN 160 ISO-F



HiPace® 800 M,
DN 200 ISO-F



HIPACE® 300 – 800 M, ATH 500 M

技术参数和订货号

技术参数

Pump type	Unit	HiPace® 300 M	ATH 500 M	HiPace® 700 M	HiPace® 800 M
Connection nominal diameter					
Flange (in)		DN 100	DN 160	DN 160	DN 200
Flange (out)	ISO-KF	DN 16	DN 25	DN 25	DN 25
Venting connection		G 1/8"	G 1/8"	G 1/8"	G 1/8"
Pumping speed for					
Nitrogen (N ₂)	l/s	255	550	685	790
Helium (He)	l/s	215	390	600	625
Hydrogen (H ₂)	l/s	170	190	480	500
Argon (Ar)	l/s	250	530	660	775
Compression ratio for					
Nitrogen (N ₂)		$> 1 \cdot 10^{11}$	$> 2 \cdot 10^7$	$> 1 \cdot 10^{11}$	$> 1 \cdot 10^{11}$
Helium (He)		$> 1 \cdot 10^8$	$> 1 \cdot 10^4$	$> 1 \cdot 10^7$	$> 1 \cdot 10^7$
Hydrogen (H ₂)		$5 \cdot 10^5$	$> 2 \cdot 10^2$	$2 \cdot 10^5$	$2 \cdot 10^5$
Argon (Ar)		$> 1 \cdot 10^{11}$	$> 8 \cdot 10^6$	$> 1 \cdot 10^{11}$	$> 1 \cdot 10^{11}$
Max. fore-vacuum pressure for					
Nitrogen (N ₂)	hPa	20	2.6	8	8
Max. gas throughput at full rotational speed for					
Nitrogen (N ₂)	hPa l/s	28	67	13	13
Argon (Ar)	hPa l/s	13	42	8	8
Ultimate pressure	hPa	$< 1 \cdot 10^{-7}$	$< 1 \cdot 10^{-8}$	$< 1 \cdot 10^{-7}$	$< 1 \cdot 10^{-7}$
Rotation speed	RPM	60,000	50,000	49,200	49,200
Run-up time	min	< 2	< 2	4	4
Cooling type, Standard		Water	Water	Water	Water
Cooling water consumption	l/min	1.3	1.0	1.3	1.3
Cooling water temperature	°C	15 – 35	15 – 25	15 – 35	15 – 35
Operating voltage ¹⁾	V DC	48 ± 5%	48 ± 5%	48 ± 5%	48 ± 5%
Max. power consumption	W	300	550	300	300
Weight	kg	13.1 – 17.2	17 – 18	15.7 – 20.8	17.1 – 21.5

¹⁾with drive electronics

You can find additional technical data and accessories on the Internet at: www.pfeiffer-vacuum.com

订货号

Pump type	HiPace® 300 M		
Interface \ flange	DN 100 ISO-K	DN 100 ISO-F	DN 100 CF-F
RS-485	PM P03 950	PM P03 951	PM P03 952
Profibus	PM P03 953	PM P03 954	PM P03 955
DeviceNet	PM P03 956	PM P03 957	PM P03 958

Pump type	ATH 500 M			ATH 500 M		
Interface, cooling \ flange	DN 100 ISO-F	DN 100 ISO-K	DN 100 CF-F	DN 160 ISO-F	DN 160 ISO-K	DN 160 CF-F
Profibus, water cooling	VY362100	VY312100	VY322100	VY462100	VY412100	VY422100
Remote, water cooling	V2362100	V2312100	V2322100	V2462100	V2412100	V2422100
Profibus, air cooling	VY361100	VY311100	VY321100	V2462100	VY411100	VY421100
Remote, air cooling	V2361100	V2311100	V2321100	V2461100	V2411100	V2421100

Pump type	ATH 500 MT			ATH 500 MT		
Interface, cooling \ flange	DN 100 ISO-F	DN 100 ISO-K	DN 100 CF-F	DN 160 ISO-F	DN 160 ISO-K	DN 160 CF-F
Remote, water cooling	VR362103	VR312103	VR322103	VR462103	VR412103	VR422103

Pump type	HiPace® 700 M		
Interface \ flange	DN 100 ISO-K	DN 160 ISO-F	DN 160 CF-F
RS-485	PM P04 450	PM P04 451	PM P04 452
Profibus	PM P04 453	PM P04 454	PM P04 455
DeviceNet	PM P04 456	PM P04 457	PM P04 458

Pump type	HiPace® 800 M		
Interface \ flange	DN 200 ISO-K	DN 200 ISO-F	DN 200 CF-F
RS-485	PM P04 460	PM P04 461	PM P04 462
Profibus	PM P04 463	PM P04 464	PM P04 465
DeviceNet	PM P04 466	PM P04 467	PM P04 468

ATH 500 MT = 温控管理

ATH 1600 – 3200 M, ATP 2300 M

抽速等级在1400-2800升/秒的紧凑型 磁悬浮涡轮分子泵

可靠

我们ATH M和ATP¹⁾ M系列的磁悬浮涡轮分子泵拥有5轴磁轴转子监测系统和实时的转子位移自动修正功能。通过采用这种高性能的轴承技术，我们的泵不仅能确保长时间的稳定性和可靠性，同时运行时也非常安静。此系列轴承技术的泵在半导体、镀膜和干蚀刻等离子体过程行业的高真空工艺中具有标杆地位，此外也广泛应用于许多其他工业行业和研发领域。

¹⁾ATP = no Holweck stage



ATH 1603 M,
with drive electronics OBC V4



ATH 2303 M,
with drive electronics OBC V4



ATH 2800 M



ATH 3200 M

产品优势

- 无润滑油的磁轴承技术实现真正的洁净真空
- 对所有过程气体都能实现高气流量
- 出色的稳定性和可靠性
- 更好的前级泵兼容性
- 气体进入稳定性高
- 免维护低成本保养费
- 转速可选范围大，适合定制化工艺需求
- 极低的噪音和震动
- 可任意角度安装
- 磁轴技术实现转子实时监测

高性能

我们的磁悬浮分子泵广泛应用于高气流和高工作压力的真空工艺。在研发领域，我们的产品即便在极限真空相对较低的情况下，其震动仍旧微乎其微。宽泛的转速范围为各种工艺要求都提供了可能，甚至可以直接替换陈旧的高真空泵以适应抽速的要求。

安全

在突然停电时，即便没有任何电源供电的情况下，转子仍能持续运转一段时间，并且缓慢地落到安全轴承上。同时在大量大气直接进入或者泵的控制器和通讯线断开的情况下，安全轴承也能起到很好的保护作用。轴承的状态是由控制器进行实时监控。在大量的大气进入或者受到强烈的外力冲击时，由控制器控制的放气阀可以有效快速的进行紧急制动以避免分子泵遭到毁坏。

在ATH M系列的分子泵中，带有MT型号分子泵配有集成加热带可以进行温度控制。其自带加热系统和水冷系统同时作用，可以确保泵的工作温度相对恒定(最高工作温度75°C)，同时最小化过程化学物或副产物在泵体内因冷凝而产生的沉积。

产品型号和应用领域对照表

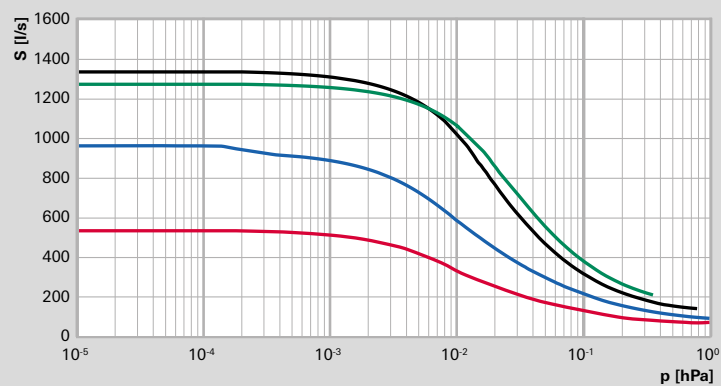
■ 推荐		分析仪器					半导体					镀膜					工业					研发																								
		Electron microscopy - 电子显微镜	Leak detection - 检漏	Mass spectrometry - 质谱	Surface analysis - 表面分析	Plasma monitoring - 等离子体监测	Residual gas analysis - 残余气体分析	Lithography	PVD (Physical Vapor Deposition)	CVD (Chemical Vapor Deposition)	Plasma etching	Implantation – Source	Implantation – Beamline	Inspection	Bonding	MBE (Molecular Beam Epitaxy)	Load-locks, transfer chambers, handling systems	Flat Panel Display (FPD) - 平板显示	LED / OLED	Hard disk coating - 硬盘镀膜	Photovoltaics - 光伏	Glass coating (PVD) - 玻璃镀膜	CD / DVD / Blu-ray production (PVD)	Optical coating (PVD) - 光学镀膜	Wear protection (PVD, CVD) - 硬质涂层	Web coating - 卷绕镀膜	Medical technology - 医学技术	Industrial leak detection - 工业检漏	Electron beam welding - 电子束焊接	Isolation vacuums - 隔离真空	Lamp and tube manufacturing - 灯管制造	Heat treatment - 热处理	Vacuum drying - 真空干燥	Vacuum furnaces - 真空炉	Nuclear research - 核研究	Fusion technology - 聚变技术	Plasma research - 等离子研究	Particle accelerators - 粒子加速器	Space simulation - 模拟空间站	Cryogenic research - 冷冻研究	Elementary particle physics - 基本粒子物理学	Nanotechnology - 纳米技术	Biotechnology - 生物技术			
	ATH 1603 M	■															■																													
	ATH 1600 MT																	■																												
	ATH 2303 M																																													
	ATH 2300 MT																																													
	ATH 2800 M						■																																							
	ATH 2800 MT									■																																				
	ATH 3200 M						■										■																													
	ATH 3200 MT									■																																				
	ATP 2300 M		■	■	■	■	■				■					■		■	■								■	■	■																	

ATH 1600–3200 M, ATP 2300 M

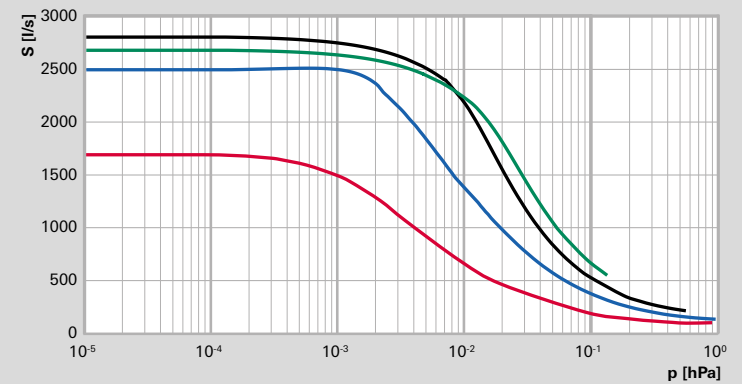
抽速和尺寸

抽速

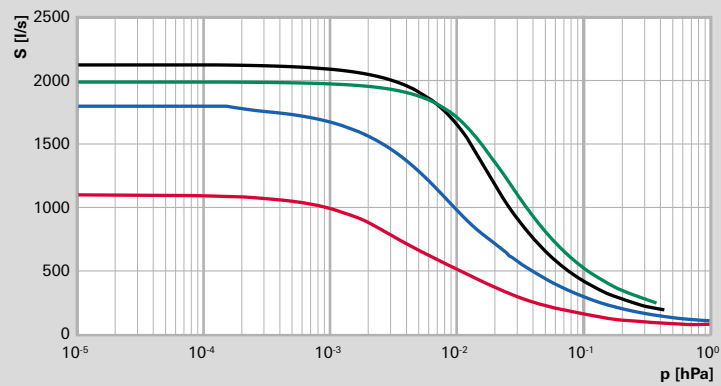
ATH 1603 M, DN 250



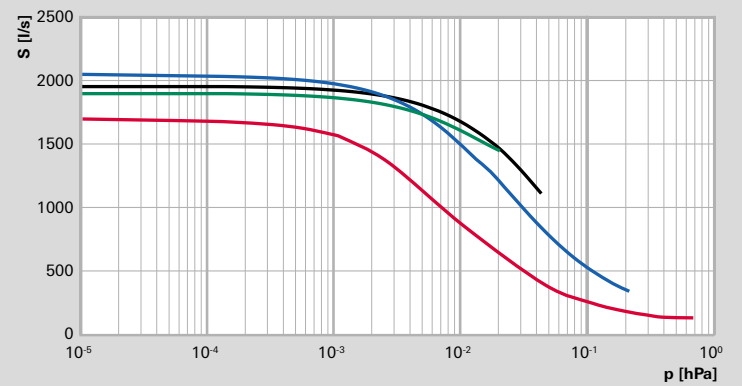
ATH 3200 M, DN 320



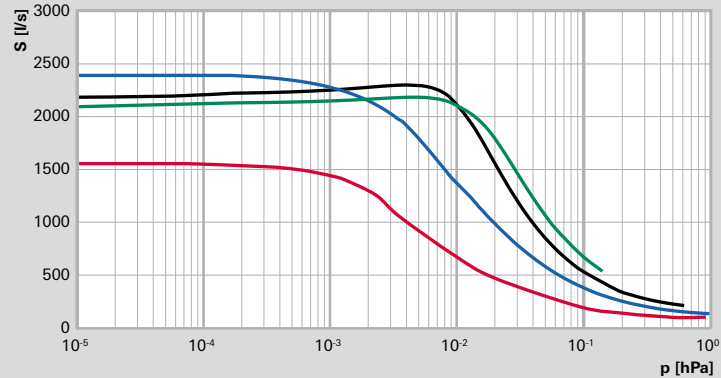
ATH 2303 M, DN 250



ATP 2300 M, DN 250



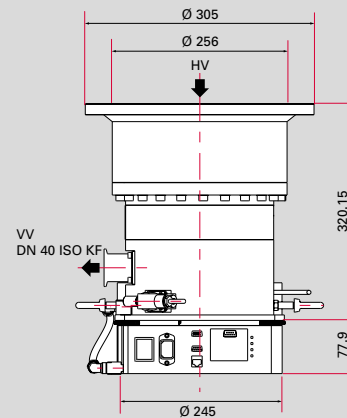
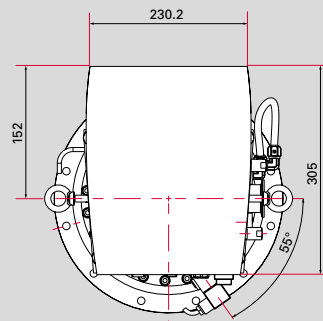
ATH 2800 M, DN 250



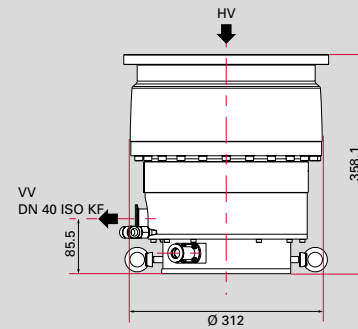
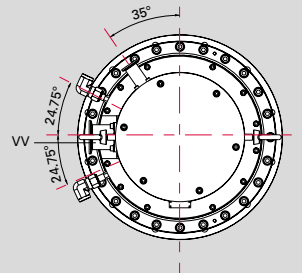
N_2 —
 He —
 H_2 —
 Ar —

尺寸

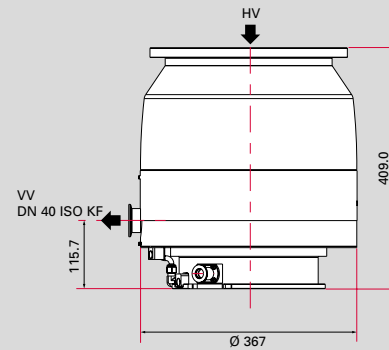
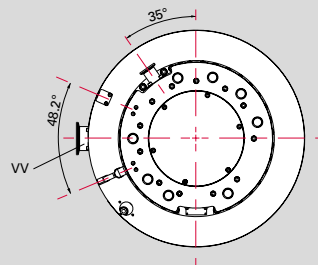
ATH 1603 M,
DN 250 ISO-F,
with integrated
drive electronics OBC V4



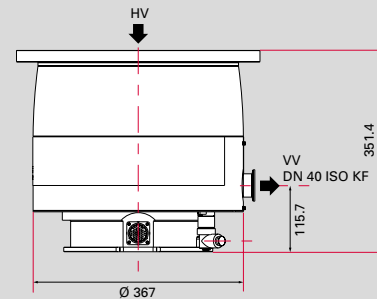
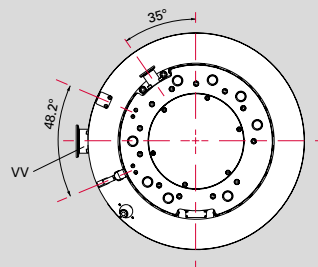
ATH 2303 M,
DN 250 ISO-F



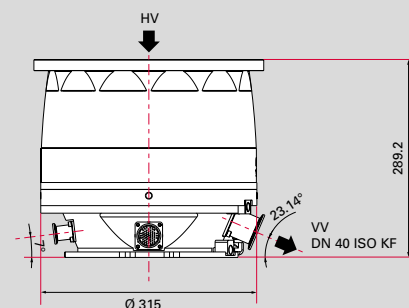
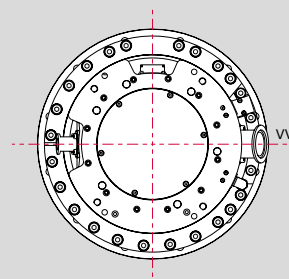
ATH 2800 M,
DN 250 ISO-F



ATH 3200 M,
DN 320 ISO-F



ATP 2300 M,
DN 250 ISO-F



ATH 1600 – 3200 M, ATP 2300 M

技术参数和订货号

技术参数

Pump type	Unit	ATH 1603 M	ATH 2303 M	ATH 2800 M	ATH 3200 M	ATP 2300 M
Connection nominal diameter						
Flange (in)		DN 250	DN 250	DN 250	DN 320	DN 250
Flange (out)	ISO-KF	DN 40	DN 40	DN 40	DN 40	DN 40
Pumping speed for						
Nitrogen (N ₂)	l/s	1,400	2,150	2,200	2,800	1,950
Helium (He)	l/s	970	1,800	2,400	2,500	2,050
Hydrogen (H ₂)	l/s	540	1,100	1,550	1,700	1,700
Argon (Ar)	l/s	1,350	2,000	2,100	2,700	1,900
Compression ratio for						
Nitrogen (N ₂)		$> 1 \cdot 10^8$	$> 1 \cdot 10^8$	$> 1 \cdot 10^8$	$> 1 \cdot 10^8$	$> 1 \cdot 10^8$
Nitrogen (N ₂)		$> 4 \cdot 10^4$	$> 3 \cdot 10^4$	$> 3 \cdot 10^4$	$> 3 \cdot 10^4$	$> 1 \cdot 10^5$
Hydrogen (H ₂)		$> 5 \cdot 10^2$	$> 1 \cdot 10^3$	$> 2 \cdot 10^3$	$> 2 \cdot 10^3$	$> 7 \cdot 10^3$
Argon (Ar)		$> 1 \cdot 10^8$	$> 1 \cdot 10^8$	$> 1 \cdot 10^8$	$> 1 \cdot 10^8$	$> 1 \cdot 10^8$
Max. fore-vacuum pressure for						
Nitrogen (N ₂)	hPa	1.7	2.9	2.1	2.1	2.1
Gas throughput for						
Nitrogen (N ₂)	hPa l/s	67	67	84	84	37
Helium (He)	hPa l/s	> 67	> 67	> 84	> 84	> 50
Hydrogen (H ₂)	hPa l/s	> 67	> 67	> 84	> 84	> 50
Argon (Ar)	hPa l/s	20	25	> 37	> 37	15
Final pressure	hPa	$< 6 \cdot 10^{-9}$	$< 6 \cdot 10^{-9}$	$< 6 \cdot 10^{-9}$	$< 6 \cdot 10^{-9}$	$< 4 \cdot 10^{-9}$
RPM	RPM	39,000	31,000	25,000	25,000	31,000
Run-up time	min	< 6	< 8	< 10	< 10	< 8
Cooling type, Standard		Water	Water	Water	Water	Water
Cooling water consumption	l/min	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Cooling water temperature	°C	15 – 25	15 – 25	15 – 25	15 – 25	15 – 25
Power connection: voltage	V AC	200 – 240	200 – 240	200 – 240	200 – 240	200 – 240
Max. power consumption	W	650	1,000	1,000	1,000	1,000
Weight ¹⁾	kg	42	68	93	93	60

订货号

Pump type	ATH 1603 M				ATH 2303 M	
Interface \ flange	DN 200 ISO-F	DN 200 CF-F	DN 250 ISO-F	DN 250 CF-F	DN 250 ISO-F	DN 250 CF-F
External drive electronics	Y2562100	Y2522100	Y2662100	Y2622100	X2662100	X2622100
OBC V4 Profibus	YN56215A	YN52215A	YN66215A	YN62215A	XN66215A	XN62215A
OBC V4 DeviceNet	YL56215A	YL52215A	YL66215A	YL62215A	XL66215A	XL62215A
OBC V4 Remote	YJ56215A	YJ52215A	YJ66215A	YJ62215A	XL66215A	XJ62215A

Pump type	ATH 2800 M		ATH 3200 M		ATP 2300 M	
Interface \ flange	DN 250 ISO-F	VG 250	DN 320	VG 350	DN 250 ISO-F	DN 250 CF-F
External drive electronics	U2662100	U26A2100	U2C62100	U2DA2100	T2662100	T2622100
OBC V4 Profibus					TN66215A	TN62215A
OBC V4 DeviceNet					TL66215A	TL62215A
OBC V4 Remote					TJ66215A	TJ62215A

技术参数

Pump type	Unit	ATH 1600 MT	ATH 2300 MT	ATH 2800 MT	ATH 3200 MT
Connection nominal diameter					
Flange (in)		DN 250	DN 250	DN 250	DN 320
Flange (in)	ISO-KF	DN 40	DN 40	DN 40	DN 40
Pumping speed for					
Nitrogen (N ₂)	l/s	1,360	2,150	2,200	2,800
Helium (He)	l/s	940	1,800	2,400	2,500
Hydrogen (H ₂)	l/s	540	1,100	1,550	1,700
Argon (Ar)	l/s	1,280	2,000	2,100	2,700
Compression ratio for					
Nitrogen (N ₂)		$> 1 \cdot 10^8$	$> 1 \cdot 10^8$	$> 1 \cdot 10^8$	$> 1 \cdot 10^8$
Helium (He)		$> 4 \cdot 10^3$	$> 3 \cdot 10^4$	$> 3 \cdot 10^4$	$> 3 \cdot 10^4$
Hydrogen (H ₂)		$> 5 \cdot 10^2$	$> 2 \cdot 10^3$	$> 2 \cdot 10^3$	$> 2 \cdot 10^3$
Argon (Ar)		$> 1 \cdot 10^8$	$> 1 \cdot 10^8$	$> 1 \cdot 10^8$	$> 1 \cdot 10^8$
Max. fore-vacuum pressure for					
Nitrogen (N ₂)	hPa	2.2	2.8	2.1	2.1
Gas throughput for					
Nitrogen (N ₂)	hPa l/s	67	67	84	84
Helium (He)	hPa l/s	> 67	> 67	> 84	> 84
Hydrogen (H ₂)	hPa l/s	> 67	> 67	> 84	> 84
Argon (Ar)	hPa l/s	20	25	> 37	> 37
Ultimate pressure	hPa	$< 6 \cdot 10^{-9}$	$< 6 \cdot 10^{-9}$	$< 6 \cdot 10^{-9}$	$< 6 \cdot 10^{-9}$
Rotation speed	RPM	39,000	31,000	25,000	25,000
Run-up time	min	< 6	< 8	< 10	< 10
Cooling type, Standard		Water	Water	Water	Water
Cooling water consumption	l/min	1.0	1.0	1.0	1.0
Cooling water temperature	°C	15 – 25	15 – 25	15 – 25	15 – 25
Power connection: voltage	V AC	200 – 240	200 – 240	200 – 240	200 – 240
Max. power consumption	W	650	1,000	1,000	1,000
Weight ¹⁾	kg	42	68	93	93

¹⁾Weight including drive electronics 8 kg

You can find additional technical data and accessories on the Internet at: www.pfeiffer-vacuum.com

订货号

Pump type	ATH 1600 MT				ATH 2300 MT		
Interface \ flange	DN 200 ISO-F	DN 200 CF-F	DN 250 ISO-F	DN 250 CF-F	DN 200 ISO-F	DN 250 ISO-F	DN 250 CF-F
External drive electronics	P6562100	P6522100	P6662100	P6622100	Q6562100	Q6662100	Q6622100
OBC V4 Profibus	PM56215A	PM52215A	PM66215A	PM62215A	QM56215A	QM66215A	QM62215A
OBC V4 Remote	PI56215A	PI52215A	PM66215A	PI62215A	QI56215A	QI66215A	QI62215A

Pump type	ATH 2800 MT		ATH 3200 MT	
Interface \ flange	DN 250 ISO-F	VG 250	DN 320 ISO-F	VG 350
External drive electronics	U6662100	U66A2100	U6C62100	U6DA2100

Further configurations on request.

我们提供一站式真空解决方案

普发真空代表着为客户在世界范围内提供创新的、定制化的真空解决方案，完美的技术，全方位的支持和可靠的服务。

完整的产品线

从一个配件到复杂的真空系统：

我们是唯一能提供完整的产品线和技术服务的供应商。

理论与实践的完美结合

得益于我们的专业技术和完善的培训体系！

我们提供给您完整的生产技术提升方案和全球统一的一流的现场服务。

您是否正在寻找
完美的真空解决方案？
请联系我们：

普发真空技术（上海）有限公司
Pfeiffer Vacuum
(Shanghai) Co., Ltd.
T +86 (21) 3393 3940
info@pfeiffer-vacuum.cn

Pfeiffer Vacuum GmbH
德国总部
T +49 6441 802-0
info@pfeiffer-vacuum.de

www.pfeiffer-vacuum.cn

All data subject to change without prior notice. PT 0191PZH (June 2016/10)

